

玉衡RIBER

离子束刻蚀机

纳米级物理刻蚀设备



离子源自主可控



多工作模式



适应多种工作气体



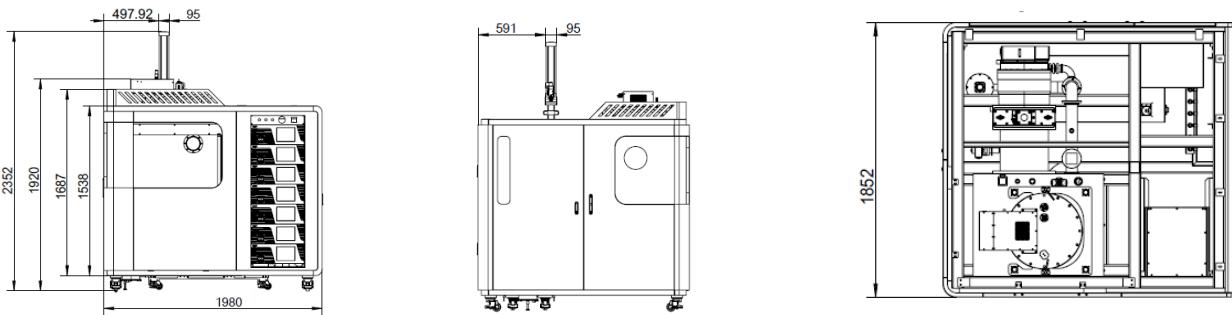
适用于多种材料



高精度刻蚀



高可靠性



产品特点

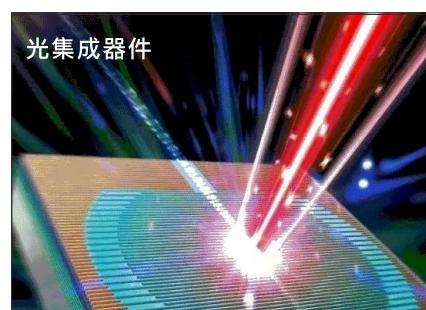
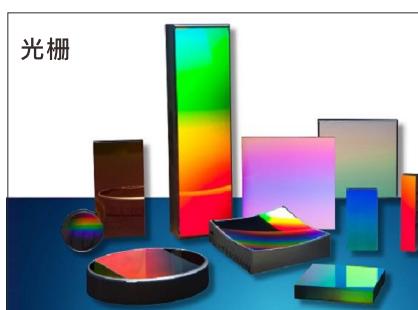
- 核心部件离子源自主可控
- 兼容IBE与RIBE，工作模式可选
- 适用于多种材料的高精度刻蚀，线宽尺寸可达20nm
- 良好的工艺能力与生产可靠性
- SiO/Si光栅底部及侧壁平直

设备参数	技术指标
可刻蚀尺寸	4英寸(圆形覆盖)、6英寸(圆形覆盖) 8英寸(矩形扫描)、12英寸(矩形扫描)
刻蚀均匀性	$\pm 5\%$
可刻蚀材料	SiO ₂ 、SiNx、蓝宝石、金刚石、铌酸锂、金属氧化物等
可用气体	N ₂ 、O ₂ 、Ar、氟基或混合气体等
样品控温	-30°C/10°C~室温
背氦冷却	可选配
传输腔及LoadLock	可选配
刻蚀离子源	 圆形和矩形可选配
	RF电源: 1000W 离子束能量: 1000eV 离子束流: 1000mA

■ 本资料仅供说明之用，图片及技术规格如有变更，恕不另行通知。

应用领域

平面光栅、大面积特种光栅、DOE衍射元器件、MEMS类器件、薄膜电路、光子集成器件



公司简介

“博顿光电”是一家专业从事新型离子源及离子束装备关键技术研发、设计和制造的创新型高科技企业。

博顿光电致力于通过高端离子源核心技术及离子束装备的国产化，在离子束微纳加工核心部件与整机装备细分领域取得突破、成为行业“单打”冠军，打破国外垄断，解决国内在高端离子源及离子束设备领域“用不上”和“用不起”的行业困局，从上游核心部件解决精密光电行业的“卡脖子”问题，有力支撑我国精密光学、光通信、OLED、半导体等战略性产业的创新和发展升级，带动相关产业和行业的能力与价值提升。

博顿光电 | 离子束核心技术引领者

